PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-302034

(43)Date of publication of application: 02.11.1999

(51)Int.CI.

C03C 3/091 CO3C 3/097 C03C 10/04 H01L 23/04 H03H 9/10 H03H 9/25

(21)Application number: 10-110380

(71)Applicant: NEC KANSAI LTD

(22)Date of filing:

21.04.1998

(72)Inventor: GOTO YOSHIHIRO

ISHIJIMA MASAYA

MORIZAKI YASUTOSHI

(54) GLASS-CERAMIC COMPOSITE AND FLAT PACKAGE TYPE PIEZOELECTRIC PARTS USING THE SAME (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain high reliability piezoelectric parts by dispersing a specified amt. of forsterite in glass and providing a composite with a specified coefft. of thermal expansion.

SOLUTION: The glass-ceramic composite is obtd. by dispersing 30-70 wt.% forsterite in glass and has a coefft. of thermal expansion of $100 \times 10-7-150 \times 10-7$. The compsn. of the glass consists preferably of, by weight, 50-70%SiO2, 2-15% Al2O3, 5-30% (Rx)O (Rx is one or more elements selected from among Ca, Sr and Ba), 1-8% B2O3, 2-15% ZnO and 5-30% (Ry)2O (Ry is one or more elements selected from among Na, K and Li). One or more additives selected from among ZrO2, TiO2, SnO2, P2O5 and MoO3 are preferably added to the composite by 0.2-5 wt.% in the form of fine powder of 0.1-1 µm particle diameter.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

01.04.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2003-07339

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of 28.04.2003

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平11-302034

(43)公開日 平成11年(1999)11月2日

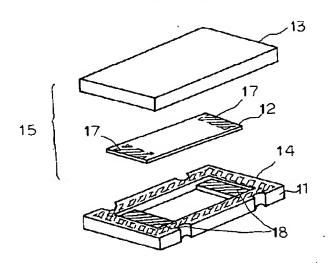
(51) Int. C1. 6		識別部	2号		FI							
C 0 3 C	3/091				C 0 3 C	3/091		•				
	3/097					3/097						
	10/04			•		10/04		•				
H01L	23/04				H01L	23/04	В					
H03H	9/10				H 0 3 H	9/10						
	審査請求	未請求	請求項の数12	OL			(全8頁)	最終頁に続く				
(21)出願番号	特願	平10-11	0380		(71)出願人	. 000156950 関西日本電気株式会社						
(22)出願日	平成	10年(19	98)4月21日			番1号						
					(72)発明者	後藤	芳宏					
		٠					大津市晴嵐2丁目9 式会社内	番1号 関西日本				
•					(72)発明者	石嶋	正弥					
		•					大津市晴嵐2丁目9 式会社内	番1号 関西日本				
					(72)発明者	森崎	康年					
						滋賀県	大津市晴嵐2丁目97	番1号 関西日本				
						電気株	式会社内					
•	,				(74)代理人	. 弁理士	工藤一郎					
	•											

(54) 【発明の名称】ガラスーセラミック複合体およびそれを用いたフラットパッケージ型圧電部品

(57) 【要約】

【課題】 水晶振動子では、パッケージと水晶片の熱膨 張率が異なるので、加熱冷却後に、応力歪が発生し水晶 振動子の共振周波数が変動し、目的とする周波数特性が 得られない。

【解決手段】 水晶板や表面弾性波素子基板やガラスエ ポキシ製プリント基板の熱膨張率に近いパッケージ材料 として、セラミックとガラスを混合したものを選択して パッケージ15を製作する。抗折強度を必要な強度にす るため、ガラス及びセラミックを十分微粉化したものを 使用するとともにさらに抗折強度を改善するためにガラ ス組成中に結晶の核となる物質(P2O5)を含ませる か、ガラスーセラミックへの添加物としてジルコニア (ZrO₅)を混合させ、焼成時にガラスを結晶化させ て抗折強度を向上させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】熱膨張係数が100~150×10⁻⁷であってガラス中にフォルステライトを30~70重量%分散させたガラスーセラミック複合体。

【請求項2】前記ガラスは、重量%で、SiO₂が50 ~70%、Al₂O₃が2~15%、(Rx)Oが5~ 30%(但し(Rx)はCa、Sr、Baから選ばれる 1又は2以上の元素)、B₂O₃が1~8%、ZnOが 2~15%、(Ry)₂Oが5~30%(但し(Ry) はNa、K、Liから選ばれる1又は2以上の元素)か 10 らなる請求項1記載のガラスーセラミック複合体。

【請求項3】前記ガラスは、重量%で、SiO₂が70~86%、P₂O₅が1~10%、MgOが1~5%、(Rz)₂Oが8~25%(但し(Rz)はK、Liから選ばれる1又は2の元素)からなる請求項1記載のガラスーセラミック複合体。

【請求項4】前記ガラスは、重量%で、SiO₂が40 ~55%、Al₂O₃が20~30%、P₂O₅が1~ 20%、BaOが1~5%、Na₂Oが1~10%、 (Rw)₂Oが1~5% (但し (Rw) はLi、K、か 20 5選ばれる1又は2の元素)、からなる請求項1記載の

【請求項5】前記ガラス及びセラミックは、平均粒径 0.3~3 μ mである請求項1~4のいずれか一に記載のガラスーセラミック複合体。

ガラスーセラミック複合体。

【請求項6】請求項2記載のガラスセラミック複合体の材料に、ZrO₂、TiO₂、SnO₂、P₂O₅、MοO₅から選ばれる1又は2種以上の粒径0.1~1μmの微粉末を重量%で0.2~5%添加した材料からなるガラスーセラミック複合体。

【請求項7】略矩形であって、ベースの長手方向に略矩形の水晶振動子片を配する構造のフラットパッケージであって、このベースは、請求項1~6のいづれか一に記載のガラスーセラミック複合体からなるとともに、電極パッドが設けられており、この電極パッドに前記水晶振動子片を直接的に接続する構造のフラットパッケージ。

【請求項8】請求項7記載のフラットパッケージに水晶 振動子片を配した水晶振動子。

【請求項9】略矩形であって、ベースの長手方向に略矩 基板で形成される表面弾性波素子を、表面実装型パック形の表面弾性波素子片を配する構造のフラットパッケー 40 デであって、このベースは、請求項1~6のいづれかー に記載のガラスーセラミック複合体からなるとともに、 電極パッドが設けられており、この電極パッドに前記表 第の金属製キャップとベース部をAu-Sn等のロウを面弾性波素子片を直接的に接続する構造のフラットパッ で気密封止するか、あるいは前記金属製キャップを溶射ケージ。

【請求項10】請求項9記載のフラットパッケージに、 表面弾性波素子片を配した表面弾性波素子。

【請求項11】前記表面弾性波素子片は、水晶、サファイヤ、ニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウム、四硼酸リチウムのうちいずれか一の単結晶からなる請求項10 50

記載の表面弾性波素子。

【請求項12】略矩形であって、ベースの長手方向に略矩形の半導体素子片を配する構造のフラットパッケージであって、このベースは、請求項1~6のいづれか一に記載のガラスーセラミック複合体からなるとともに、電極パッドが設けられており、この電極パッドに前記半導体素子片をを直接的に接続する構造のフラットパッケージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は信頼性の高い水晶振動子やSAWフィルター等の圧電部品および半導体素子の面実装用フラットパッケージに関するものである。

[0002]

【従来の技術】水晶振動子等のデバイスを面実装部品として使用する場合、図8に示すようにアルミナを主材料とするベース部材81に水晶片82を固着したのちアルミナを主材とするキャップ部材83をかぶせ、低融点のガラス封止部84で気密封止して使用している。封止されたパッケージ85は回路基板上にはんだリフロー法等で実装される。パッケージを封止する際や、回路基板に実装する際には、パッケージは加熱されるが、パッケージ85と、水晶片82の熱膨張率が異なるため、加熱冷却後に水晶片82に応力歪が発生する。そのため水晶片82の共振周波数が変動し、目的とする周波数特性が得られない。

【0003】その対策として、例えば、「ELECTR ONICS UPDATE」(1990年第4号P83~P88)に述べられている前記図8の構造のようにべ30 一ス部材81に水晶片82をばね性のサポータ86を介して固着したのち気密封止して使用している。あるいは、図9のごとく特開平2一105710号公報に述べられているように、水晶片92の電極リード部97を水晶片92の同じ端部に導き、水晶片92を直接ベース部材91上にサポータを介さずに電極パッド部98に固着する方法も提案されている。

【0004】また、水晶や、ニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウム、サファイヤ、四硼酸リチウム等の圧電性基板で形成される表面弾性波素子を、表面実装型パッケージに搭載して表面弾性波フィルターとして成す場合、従来はアルミナを主材とするベース部にはんだボール等の金属製キャップとベース部をAuーSn等のロウ材で気密封止するか、あるいは前記金属製キャップを溶接でベース部に気密封止するかして使用していた。また、半導体素子を表面実装型パッケージに搭載する場合、従来はアルミナ製セラミックパッケージに搭載するか、樹脂性の配線基板に搭載し表面を樹脂で被覆して擬似パッケージとして製品を完成させていた。前記表面実装型水晶振動子、表面弾性波フィルター、半導体素子は、ガラ

スエポキシ製のプリント基板にはんだリフロー法等では んだ接続していた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、前述の表面 実装用水晶振動子、弾性表面波フィルター、半導体素子 は次のような問題を有している。まず、水晶振動子で は、パッケージと水晶片の熱膨張率が異なるので、加熱 冷却後に、応力歪が発生し水晶振動子の共振周波数が変 動し、目的とする周波数特性が得られない。前記課題を 解決するために、水晶片をばね性のサポータを介してパ 10 ッケージに接続する場合、製造コストが高くなる、ま た、パッケージが厚くなる等の問題がある。

【0006】さらに、パッケージの主材料であるアルミ ナ (Al₂O₃) は焼結温度が1500~1600° C であり、パッケージ内部の配線導体を同時焼成する場 合、導体として、タングステン(W)、モリブデン(M o) 等の高融点金属を使用する必要がある。これら高融 点金属は電気電導率が低くまた半田付けができないの で、ニッケル(Ni)メッキ、及び金(Au)メッキを 施す必要がある。そのため製造時に、工数、コストとも 20 多大なものとなっている。

【0007】次に表面弾性波フィルターでは、例えば温 度サイクル試験で、索子を直接パッケージに固着してい るはんだボール接続部分に亀裂が発生し電気的な接続が 不十分になるとともに固着力が低下し、落下衝撃時に表 面弾性波素子が脱落して機能しなくなる場合が発生して いた。また、半導体素子を表面実装型パッケージに搭載 してプリント基板に実装する場合、表面実装型パッケー ジはアルミナ製セラミックパッケージかもしくは樹脂性 基板に搭載後樹脂モールドしたものかであるが、これら 30 表面実装型水晶振動子、表面波フィルター、半導体素子 をガラスエポキシ製プリント基板にはんだリフロー法で はんだ接続したものは、温度サイクル試験ではんだ接続 部に亀裂が発生し、接続不良を生じる場合があった。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明では、水晶板や表 面弾性波索子基板やガラスエポキシ製プリント基板の熱 膨張率に近いパッケージ材料を選択する。パッケージ材 料として、セラミックとガラスを混合したものを使用 し、例えば、パッケージの焼成温度を800°C~10 40 体に切断し、熱膨張係数、抗折強度を測定した。 00°Cとする。抗折強度を必要な強度に改善するた め、ガラス及びセラミックを十分微粉化したものを使用

するとともにさらに抗折強度を改善するためにガラス組 成中に結晶の核となる物質(P2〇g)を含ませるか、 ガラスーセラミックへの添加物としてジルコニア (Zr O₂)を混合させ、焼成時にガラスを結晶化させて抗折 強度を向上させる。

[0009]

【作用】水晶振動子用パッケージとして使用する場合、 パッケージ材料と水晶板の熱膨張率が整合し、加熱冷却 後に水晶振動子の残留歪が低減され、共振周波数の変動 が抑えられる。表面弾性波素フィルター用パッケージと して使用する場合、表面弾性波素子との熱膨張率が整合 し、表面弾性波素子をはんだボール等で直接パッケージ に固着しても、温度サイクルによるはんだボールへの亀 裂発生を抑えることができるので、厚みが薄く信頼性の 高い表面波弾性フィルターを実現することができる。

【0010】また、半導体素子用表面実装型パッケージ として使用する場合や前記水晶振動子用パッケージ、表 面弾性波フィルター用パッケージとして使用する場合 も、これらパッケージとガラスエポキシ製プリント基板 の熱膨張率が整合し、パッケージをプリント基板にはん だ接続してもはんだ接続部分の亀裂発生を抑えることが でき表面実装部品としての信頼性が向上する。

【0011】さらにパッケージの焼成温度が低下でき、 内部導体を同時焼成する場合、Ag, Ag/Pd, Ag /Au、Ag/Pt、Cu等の低融点金属を使用でき る。またこれらの金属材料は、電気伝導率を高く、かつ 比率を選択することにより、半田付けが可能なためメッ キ工程を必要としない。よって、製造コストが低減し、 製造工期も短縮される。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明について実施例に基 づいて詳細に説明する。まず、 [表1] に本発明のガラ スーセラミック複合体の組成と特性について実施例の結 果を示す。なお表1にはガラス自体の膨張係数も示す。 各実施例において、ガラス成分およびフォルステライト (2MgO・SiO2)の粉末を湿式ボールミルで粉砕 混合して平均粒径が 0.3~3μmとなるように微粉末 化し、乾燥、らいかい後、粉末成形プレスを行い、大気 中に800~1000° C1~2時間焼成したのち直方

【0013】それらの結果は表1に示す通りである。 【表1】

17入成分 SiO2	5																
(表別	ガラ	ユーナラミッ	ク祖 4	そ体の	组成	および	144	A									
大田子 10		~	7						2	12	13	14	15	3	15	17	18
A12O3	ラス皮分	5/02				•	· · · · ·			70							
Region Page Pag					3					4					3		
日本の										5							
P2OS BeC O O O O O O O O O					ī		1										
日本日					'n		- 1										
Mar O					-		- 1										
(円元)					-		- 1					1	•				
(下) 20 22 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1				-		- 1										
(元) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0							- 1										
保険 20							- 1										
記述							- 1										
理事後 セラミック 50 49.5 47.5 34.5 84.5 50 49.5 49 34.5 84.5 50 49.5 49 34.5 84.5 2702 0 6 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1									40.5		000	44.5		10.5		645	
社 無路機																	
機能 120 116 115 125 108 103 100 97 105 100 106 104 101 102 10 × 10 ⁻⁷ C (2D~400°C)	重量%)			49.5		34.5	64.5		49.5		34.5	64.5		49.5	49	J4.5	84.5
X 10						1									2	!_	1
(2D~400°C) 抗抗速度 1800 3200 2900 2500 2800 1950 3100 2700 2380 2550 1850 3050 2520 2210 241 1820 3050 2520 2730 1820 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820	PE			118	115	129	108	103	100	97	105	100	108	104	101	102	100
技術技術 1800 3200 2900 2500 2800 1950 3100 2700 2380 2550 1850 3050 2520 2210 241		× 10-1/	.с														
技術技術 1800 3200 2900 2500 2800 1950 3100 2700 2380 2550 1850 3050 2520 2210 241		(20~40)). C)														
Kg/cm		抗折选度	1800	3200	2900	2500	2800	1950	1100	2700	2380	2550	1850	3050	2520	2210	2410
接触 18 4 20 21 22 23 5 24 25 26 27 6 28 29 3 17 7 7 20 11																	
ラス成分 SiO2	-																
A 203 3 2 15 15 15 17 10 10 10 10 10 10 10			19	4		21	22	23	5		25	26	27	6		29	30
ZPO	ラス成分												i				
B2O3		AI203			3								l		15		
P205 B=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Z _n O			11					5			l		5		
B=O MgO D D D D D D D D D		8203			1					- 1			l		1		
MgO		P205			D			1		0			l		0		
(Ru)2O 30 11 10 10 (Ry)2O 5 30 30 22 (Ru)2O 0 0 0 0 0 0 0 0 0		B=O			0			ŀ		o			l		Ó		
(Ru)2O 30 11 10 10 (Ry)2O 5 30 30 22 (Ru)2O 0 0 0 0 0 0 0 0 0		MaD			Ō					0			l		0		
(Rw)2O			l										l				
(Rai 2C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1										l				
(日本) 20																	
技術 プラス 50 495 49 645 34.5 50 49.5 49 34.5 64.5 49 34.5 49 34.5 64.5 49 34.5							!						1				
置重物) セラミック 50 495 49 34.5 64.5 50 49.5 49 34.5 64.5 50 49.5 49 34.5 64.5 50 49.5 49 34.5 64.5 50 49.5 49 34.5 64.5 50 49.5 49 34.5 64.5 50 49.5 49 34.5 64.5 50 49.5 49 34.5 64.5 50 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5	4 +4 1+		50	40.5		64.6	24.5	50	495		645	34 5	45	405		445	34 5
大口 2 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1																	
特性 誘導権 118 118 118 128 105 123 121 120 135 112 120 119 117 128 10 × 10 - 7 C (20 - 400 °C)	是里70/			-53		34.3	04.5		79.3	73		04.3				343	4.5
K10 ⁻⁷ C (20~400°C) TUTHER ISOO 3150 3000 2550 2730 1800 2800 2500 2300 2450 1650 3050 2950 2420 275 TUTHER ISOO 3150 3000 2550 2730 1800 2800 2500 2300 2450 1650 3050 2950 2420 275 TUTHER ISOO 3150 3050 2950 2450 1750 3050 2950 2450 1750 3050 2950 2450 1750 3050 2950 2450 2750 2750 TUTHER ISOO 3150 3050 2950 2450 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 27	434			110		124	105		121	120		112				178	108
(20~400°C)	41X			1.0	113	120	100	'2"	121	120	133	112	1 ''		•••	120	
大田神田								ı									
技術 31 32 33 34 35 36 37 38 39 49 41 42 43 44 44		(20~40	D. C1			A-22							1				
数値例			1800	3150	3000	2550	2/30	1 600	2800	2500	2300	2450	11030	3050	2950	2420	2/50
プス成分 3CO2 300 75 82 65 78 70 84 50 55 40 5 24 30 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Kg/om						L					<u> </u>				
プス成分 3C(22 30 75 62 63 78 70 84 50 55 40 50 Al2O3 O O O O O O O O O	SHE/IN		21	201	30	7.4	25	26	771	70	30	40		42	42	44	45
AI2O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 24 30 2 B2O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	152 ST	9102					- 43		3!					74			58
ZnQ	, , ~ mi. m																20
B2O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	1 6
P2O5 8 10 6 1 4 3 2 9 1 18 BaO 0 0 0 0 0 0 0 1 5 MgO 1 1 1 5 2 5 3 0 0 0 (Px)O 0 0 0 0 0 0 0 0 0							l		1						_		
BaO																	1 18
MgO 1 1 1 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0							l									' '	
Rxy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							ı									'	1 :
R _y 2O						5	l										1 9
(R2)20																	9
Rw ² 2O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 10 10 1																	1
(記世) プラス 50 50 50 50 40 50 60 50 50 50 50 50 5																	1 :
運量%) セラミック 30 50 50 50 60 50 40 50 50 50 45 40 30 70 1 2702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
Z _C O2		カラス															
9性 厳勝後事 129 t35 t25 t15 115 120 t25 120 118 135 140 t44 142 132 t3 × 10 ⁻⁷ /°C	(重量%)		50	50	50	50	60	50	40	50	50	50	45	40	30	70	50
×10-7/C		Zr02							. 0							L Q	
×10 ⁻⁷ /C	竹生	殷野福率	129	135	125	115	115	120	125	120	118	135	140	144	142	132	133
((20~400°C)	_	X 10-7/	°c l	l		1	1				l.	l			1	l	
		(20-40	0,0			l	}				į .	l			l l	1	

【0014】また、特に実施例1、実施例31と実施例 40の組成のものについて温度に対する伸びを従来のも のと比較して図2に示した。本発明のものは。ほぼ水晶 と同様の伸びを示し、従来のものより大幅に改良されて いることが確認できた。

【0015】実施例1~30の組成のものは、ソーダカ リガラスに対しフォルステライトが40~60重量%混 合されており、さらに添加物として、ZrO2、TiO 2、SnO2、P2O5、MoO3から選ばれる1又は 2種以上の粒径 0. 1~1μmの微粉末を重量%でガラ スーセラミック複合体に対し0.2~5%添加されてお り、また、ガラス組成は重量%でSiO2が50~70 %, Al₂O₃%2~15%, (Rx) O%5~30% (但し (Rx) はCa, Sr, Baから選ばれる1ま たは2以上の元素)、B₂O₃が1~8%、ZnOが2 ~15%、(RyO) 20が5~30% (ただし (R y) はNa、K、Liから選ばれる1又は2以上の元 素)である第一群のガラスーセラミック複合体として区 分できる。このガラスセラミック複合体は熱膨張係数が 略100~140×10^{~~}/°Cであり水晶(Zロン 50 500kg/cm²と大きく、パッケージ材料として好

グ) の139×10⁻⁷/° Cよりは小さいがかなり近 い値であって、従来のアルミナ (熱膨張係数=70~8 0×10⁻⁷/°C)に比べて格段に改善されている。 また、ガラスの結晶化と成分材料の微粉化により抗折強 度もほとんどの組成のものが、2000~3200kg / c m²と大きく、パッケージ材料として好適する。

【0016】次に実施例31~39のものは、リチウム 系の結晶化ガラス(ガラス自体の熱膨張率は110~1 60×10-7/° C程度のもの) に対してフォルステ 40 ライトが40~60重量%混合されており、またガラス 組成は重量%でSiO2が70~86、P2O5が1~ 10、MgOが1~5、 (Rz) 2Oが8~25% (但 し、(Rz)はK, Liから選ばれる1又は2の元素) である第2群のガラスセラミック複合体として区分でき る。このガラスセラミック複合体は熱膨張係数が略10 0~140×10⁻⁷/° Cであり水晶(Zロング)の 139×10⁻⁻/。 Cよりは小さいがかなり近い値で あって、優れた材料である。また、ガラスの結晶化と微 粉末化により抗折強度もほとんどのものが2500~4

適する。

【0017】次に実施例40~46の組成のものはシリ カーアルミナーソーダ系の結晶化ガラス(ガラス自体の 熱膨張係数は170~200×10-7/° C程度のも の)に30~70重量%のフォルステライトを混合した もので、ガラス組成は重量%比でSiO2が40~5 5, Al₂O₃ \dot{m} 20~30, P₂O₅ \dot{m} 1~20, B a O N 1 ~ 5 \ N a 2 O N 1 ~ 1 O % \ (Rw) 2 O N 1~5 (但し (Rw) はLi, Kから選ばれる1又は2 の元素)である第3群のガラスーセラミック複合体とし 10 する。 て区分できる。このシリカーアルミナーソーダ系ガラス は前記リチウム系ガラスに比べて焼結温度が低く熱膨張 係数が大きいという特徴がある。このガラスーセラミッ ク複合体は熱膨張係数が135~144×10^{ープ}/° Cであって、水晶(Zロング)の139×10⁻⁷/° Cと略一致するという従来にない優れた材料である。ま たガラスの結晶化と微粉末化により抗折強度もほとんど のものが $2500~3800 \,\mathrm{kg/cm^2}$ であり、パッ ケージ材料として好適である。

【0018】本発明のガラスーセラミック複合体は、前 20 記のように水晶と略同一か、またはこれに近い熱膨張係 数を有するにもかかわらず、従来のアルミナに近い抗折 強度を有するという特徴がある。これはガラス組成の選 定、フォルステライトの混合および微粉末化によるもの である。第一群のガラスーセラミック複合体は、ZrO 2, TiO2、SnO2、P2O5、MoO3から選ば れる1または2種以上の微粉末を添加したことにより、 これらがガラス成分の結晶の核になって強度が向上する ものである。また第二群および第三群のガラスーセラミ ック複合体はガラス成分中に適量のP2〇5を含むこと により、焼結過程を経てP2〇gが核となってガラス成 分が結晶化し強度が向上するものである。

【0019】このため本発明では、第二群および第三群 のガラス組成にはP2O5は必須成分である。また本発 明においてガラス成分に対しフォルステライトを30重 量%より少ないとフォルステライトの骨格材としての機 能が低減し焼結体の抗折強度が低下し好ましくない。ま たフォルステライトが70重量%を超えると、焼結体に 気泡が多発し抗折強度が低下するとともに焼結温度が高 くなり本発明の目的である低温度での焼結を行うことが 40 難しい。

【0020】前記第一群の組成において、SiO₂はガ ラスの骨格となる成分であり50重量%より少ないと軟 化点が低くなりすぎ耐熱性が低下するので好ましくな い。一方70重量%より多いと軟化点が高くなりすぎ焼 結温度が高くなりすぎ好ましくない。AlaOaはガラ スの機械的強度を向上するために必要であり、2重量% より少ないと焼結体の十分な強度が得られず、15重量 %より多いと焼結体の焼結3 r, B a から選ばれる1ま

調整するために添加するもので、5重量%より少ないと 溶解性が不十分になり、30重量%より多いと、低温で 安定な焼結ができにくくなる。B2〇gはガラスの耐久 性を向上させるために添加するが、8%より多いと熱膨 張率が小さくなって所望の熱膨張率を得ることが困難に なるので1~8%の範囲内で添加することが必要であ る。ZnOはガラスが結晶化する際に核の一部となるも ので、2重量%より少ないとガラスが結晶化しにくくな り強度が不足する。15重量%より多いと焼結性が低下

【0021】 (Ry) 20 (但し (Ry) はNa, K, Liから選ばれる1又は2以上の元素)は熱膨張率を大 きくする上で必要な成分であるが、30重量%より多い と、化学的耐久性が低下し、5重量%より少ないとガラ スの溶解性が低下し好ましくない。ZrOz、Ti O2、SnO2、P2O5、MoO3は核発生剤として 添加するもので、添加量が5重量%より多いと焼結時の 結晶化速度が速くなりすぎて緻密な焼結体を得ることが できない。さらに、核発生剤としてその粒径はガラスお よびフォルステライトの粒径よりも小さい微粉末として 添加する必要があり、望ましくは 平均粒径0.1~1 μmが良い。

【0022】前記第二群の組成において、SiO2はガ ラスの骨格となる成分で、86重量%より多いと軟化点 が高くなりすぎ好ましくない。70重量%より少ない と、溶融性に乏しくなる。P2Osは結晶化の核となる ものであり、10重量%を超えると分相して安定なガラ スが得られないし、1重量%より少ないと結晶化が不十 分となる。またMgOはガラスに溶融性を持たせる成分 で多すぎるとガラスの結晶化が抑制されるなど不具合が 生じるので、1~5重量%が望ましい。(Rz)O(但 し(Rz)はK、Liから選ばれる1または2の元素) は熱膨張率を大きくする上で必要な成分であるが、25 重量%より多いと、化学的耐久性が低下し、8重量%よ り少ないとガラスの溶解性が低下し好ましくない。

【0023】前記第三群の組成において、SiOz、A l₂O₃、(Rw) 2O(但し(Rw)はLi、K、か ら選ばれる1又は2の元素) はガラスの骨格となる成分 であり、いずれも前記の組成範囲が望ましい。この範囲 を超えると、結晶化が進行しない、溶融性に乏しくな る、必要な熱膨張係数が得られないといった不具合が生 じる。Na2Oは熱膨張率を大きくする上で必要な成分 であるが、10重量%より多いと、化学的耐久性が低下 し、1重量%より少ないとガラスの溶解性が低下し好ま しくない。BaOは溶融性を付与する成分であり0.2 重量%より少ないとガラスが溶けにくくなる。5重量% より多いとガラスの結晶化が進行しないといった不具合 が生じる。P2〇mは結晶核を形成する成分であり、1 重量%より少ないとガラスの結晶化が不十分となり必要 たは2以上の元素)はガラスの溶解性および熱膨張率を 50 な強度が得られない。また20重量%より多いと分相し 安定なガラスが得られない。

【0024】以上のように第一群、第二群および第三群 に記載された組成範囲を逸脱すると、水晶や表面弾性波 素子、ガラスエポキシ製プリント基板に近い熱膨張係数 を有し、かつ実用的な強度を持つガラスーセラミック複 合体を実現することが著しく困難になる。次に、本発明 のガラスーセラミック複合体を用いたフラットパッケー ジについて説明する。表1に示す実施例1、実施例31 および実施例40に示す原料粉末を使用して、以下に述 べる製造工程にしたがって従来と同等な構造のパッケー 10 ジを作成した。

【0025】(a)前記材料とバインダー、溶剤を混合 し、スラリーを製造してドクターブレード法により厚さ 100~200μmのグリーンシートを作成する。

- (b) 前記グリーンシートにスルーホールを形成し、A g/Pdペーストをスクリーン印刷し、スルーホールを 充填するとともに内部導体部を形成する。
- (c) 別のグリーンシートにAg/Pdペーストをスク リーン印刷し、外部取り出し電極部を形成する。
- (d) 別のグリーンシートに水晶振動子のキャビティ用 20 の穴を打ち抜く。
- (e)前記(b)~(d)のグリーンシートを積層し、 80°Cで200~400kg/cm²の圧力でプレス
- (f) 前記積層体を脱バインダーし、800~1000 Cで焼成する。
- (g) 焼成された積層体を切断し、図1に示すパッケー ジのベース部材11を得る。
- (h) ベース部材11と同じ混合粉末を用いてパッケー 1000°Cで焼成しキャップ部材13を得る。
- (i) 前記ベース部材1に予め低融点のガラス封止部1 4を形成しておき、図1に示す構成で前記ベース部材1 1の電極パッド部18と水晶片12の電極リード部17 を導電性接着剤で固着した後、前記キャップ部材13で 封止し、水晶振動子15を完成する。

【0026】完成した水晶振動子の共振周波数の熱処理 温度依存性を従来品と比較して調査した。水晶振動子を 40個作成し、まず室温にてそれぞれの共振周波数 (f 0) をスペクトラムアナライザーで測定した。次に各1 0個をそれぞれ、100°C, 200°C, 300° C, 400° Cで約30分加熱処理し、室温まで冷却 し、熱処理後の共振周波数 (f (T)) を測定し、下式 に従い $\triangle f / f 0$ を求めた。

 $\Delta f / f 0 = f (T) - f 0 = 熱処理後の共振周波数-$ 熱処理前の共振周波数

fO・・熱処理前の共振周波数

測定結果を [図3] に示す。 [図3] 中には前記 [図 8] に示すアルミナを主材とする従来タイプのパッケー によれば、熱処理による共振周波数の変動は従来タイプ に比較して約1/4に低減されていることがわかる。ま た実施例31、40の組成のものでは約1/8に低減さ れていることがわかる。

【0027】次に表1の他の実施例に示す原料粉末を使 用して、前記と同様の手順に従い、水晶振動子用パッケ ージを試作し水晶片を組み込んで完成したフラットパッ ケージ型水晶振動子の共振周波数の熱処理温度依存性を 従来品と比較して調査したところ図3に示す実施例1、 実施例31、または実施例40とほぼ同様な結果が得ら れた(図示は省略する)次に、表1の実施例1に示す原 料粉末を使用して前記製造手順に従って、図4に示す構 造の表面弾性波用パッケージ45に、水晶表面弾性波素 子49をはんだボールで固着し、キャップ部材43をベ ース部材41にガラス封止部44で気密封止した。その 後温度サイクル試験(最低ー30°Cで30分保持後、 最高+85°Cに急加熱し30保持する。以上を1サイ クルとして繰り返す。) での、はんだボール接続部の亀 裂の有無を調査した。はんだボール部に亀裂が発生する と電気的な接続が不十分になるとともに固着力が低下 し、落下衝撃時に表面弾性波索子が脱落して機能しなく なる。

【0028】結果を 図5に示す。比較のため 従来の アルミナ製パッケージに同様に水晶表面弾性波をはんだ ボールで固着したものの温度サイクル試験の結果のあわ せて図示した。 これによれば、従来品は 約250サ イクルからはんだボールに亀裂が発生するものが現れは じめ、400サイクルで全数に亀裂が発生した。一方本 提案のガラスセラミック製パッケージの場合、1000 ジのキャップ部材を粉末プレスにより形成し、800~ 30 サイクルではんだボールに亀裂が発生するものが現れは じめ、従来品に比較して大幅に改善されていることが確 認された。

> 【0029】次に、表1の実施例1に示す原料粉末を使 用して前記手順に従って、図6に示すようにベース部材 61に半導体素子62を設置しキャップ63で気密封止 をし半導体素子用フラットパッケージ65を作成した。 前記パッケージをガラスエポキシ製基板に半田接続した 後、前記温度サイクル試験を実施し、はんだ接続部の亀 裂の有無を調査した。結果を図7に示す。従来の樹脂性 40 フラットパッケージの温度サイクル試験の結果も併せて 示す。これによれば、従来品は 500サイクルで亀裂 が発生しはじめ、800サイクルで全数に亀裂が発生し た。一方本提案のガラスセラミック製パッケージの場 合、2000サイクルではんだ接続部に亀裂が発生する ものが現れはじめ、従来品に比較して大幅に改善されて いることが確認された。

[0030]

【発明の効果】水晶振動子や表面弾性波素子の圧電部品 の熱膨張率とパッケージの熱膨張率が整合するため、パ ジで封止された水晶振動子の結果も併せて示した。これ 50 ッケージに封止時及び、封止後の熱処理により水晶振動

子の周波数特性が変動しにくくなり、また抗折強度が向上するため衝撃や曲げの力に対して強くなり、信頼性の高い表面実装型圧電部品をえることができる。また、熱処理時の応力歪を吸収するためのばね性のサポート部材が不要になるのでパッケージの薄型化、低コスト化が図れる。また、表面弾性波素子とパッケージの熱膨張率が整合するため、素子をはんだボール等で直接パッケージに接続する場合、はんだボール接続部の亀裂の発生等を抑えることができる。

【0031】また、パッケージと、ガラスエポキシ基板等のプリント基板の熱膨張率が整合するために、圧電素子や半導体素子を搭載したパッケージをガラスエポキシ製プリント基板にはんだ接続した場合のはんだ部の亀裂発生を抑えることができ、信頼性の高い表面実装工法を実現することができる。さらに、従来のアルミナ製パッケージに比較して、本発明のガラスーセラミック複合体を用いたパッケージは焼結温度が格段に低いため製造コストを低減できる。また、外部電極にタングステン、モリブデン等の請う融点金属を使用してニッケルメッキ、金メッキなどをする必要が無いので低コスト化が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例であるガラスーセラミック パッケージを用いた水晶振動子の分解斜視図。

【図2】 本発明の一実施例であるガラスーセラミック 複合体の温度変化による伸びを従来材料と比較して示す 図。

【図3】 本発明の一実施例であるガラスーセラミック パッケージを使用した水晶振動子の共振周波数の熱処理 30

温度影響度を示す図。

【図4】 本発明の一実施例であるガラスーセラミック パッケージを用いた表面弾性波フィルターの分解斜視 図。

12

【図5】 本発明の一実施例であるガラスーセラミック パッケージを使用した表面弾性波フィルターの温度サイ クル試験時のはんだボール部接続累積不良数を示す図。

【図6】 本発明の一実施例であるガラスーセラミック 材料を使用した半導体素子搭載パッケージをガラスエポ 10 キシ製プリント基板に搭載した図。

【図7】 本発明の一実施例であるガラスーセラミックパッケージを使用した半導体素子搭載パッケージをガラスエポキシ製プリント基板にはんだ接続し、温度サイクル試験を実施後はんだボール部接続累積不良数を示す図。

【図8】 従来のセラミックパッケージを用いた水晶振動子の分解斜視図。

【図9】 従来のセラミックパッケージを用いた水晶振 動子の分解斜視図。

20 【符号の説明】

11, 41, 61 ベース部材

12 水晶片

13, 43, 63 キャップ部材

14,44 ガラス封止部

15, 45, 65 パッケージ

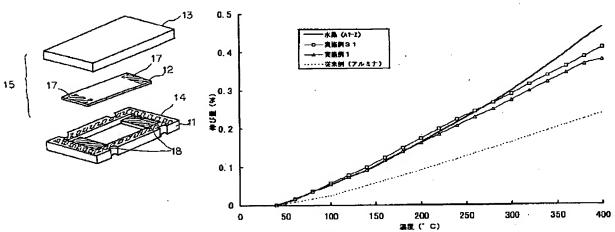
17 電極リード部

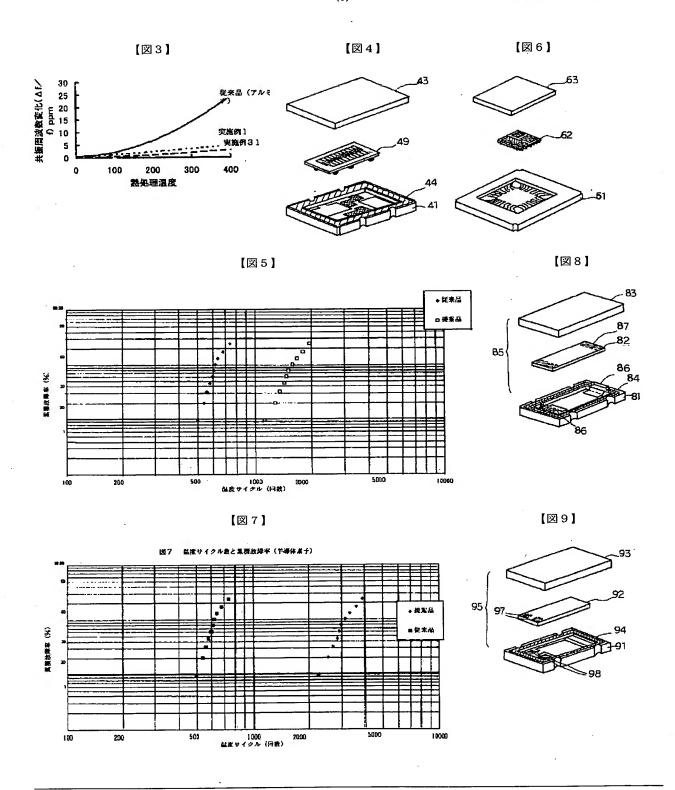
18 電極パッド部

49 SAW素子

62 半導体素子

【図1】 【図2】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶ H O 3 H 9/25 識別記号

F I

H O 3 H 9/25

Α